

薄膜技術実践セミナーV

産業技術総合研究所ナノプロセッシング施設 (NPF) は、「薄膜技術実践セミナーV」を、2020年1月22日(水)産業技術総合研究所つくば中央にて開催いたします。スパッタ成膜、プラズマCVD成膜、原子層堆積法(ALD)等、様々な成膜技術について、トピックスを交えて紹介いたします。オーサーズ・インタビューの時間を設けましたので、講演終了後に講師の先生に個別に質問をすることが可能です。

また、実習コースでは、NPFの装置を使用してSrTiO₃誘電体薄膜形成とその結晶性・電気特性評価などを盛り込んだ機能性酸化物材料の開発のための基礎的なスキルを獲得していただけるコースを準備いたしました。産学官いずれのご所属の方にも奮ってのご参加をお待ちしています。(※実習コースのみの参加はできません)

◇講演

【日時】令和2年1月22日(水)12:55~17:30

【場所】産業技術総合研究所つくば中央2-12棟第6会議室

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html

【参加費】無料

【定員】90名(先着順、参加登録をお願いします)

【セミナー案内/申し込み】

<https://www.tia-kyoyo.jp/npf/seminar/2019-3/>

◇講演プログラム

- 12:55-13:00 「はじめに」 産総研 TIA共用施設ステーション 多田哲也
- 13:00-13:30 『酸化膜積層構造を用いた新しいメモリ技術』 産業技術総合研究所 宮田典幸
- 13:30-14:00 『新型不揮発性メモリ用多元化合物材料の成膜技術』 株式会社アルバック半導体電子技術研究所 増田健
- 14:00-14:30 『ECRスパッタ成膜による酸化物・窒化物 薄膜形成技術』 JSWアフティ株式会社 神 好人
- 14:30-15:00 『ECRイオンシャワー装置を用いたリフトオフ成膜について』 株式会社エリオニクス 杉原達記
- 15:00-15:20 休憩 (オーサーズインタビュー)
- 15:20-15:50 『SPPテクノロジーズ社製プラズマCVD装置によるSiN膜などの成膜技術のご紹介』 SPP テクノロジーズ株式会社 金尾寛人
- 15:50-16:20 『高純度オゾンガスとエチレンガスを使った低温CVD・ALDプロセス』 株式会社明電舎 亀田直人
- 16:20-16:50 『ALD用原料とその原料を用いたALDプロセスの開発』 株式会社高純度化学研究所 水谷文一
- 16:50-17:10 『NPFの原子層堆積(ALD)装置による成膜紹介』 産業技術総合研究所ナノプロセッシング施設 山崎将嗣
- 17:10-17:30 オーサーズインタビュー

◇実習コース

【日時】令和2年2月 19日(水)~2月21日(金) 3日間

【場所】産業技術総合研究所つくば中央2-12棟

TIA共用施設ステーションナノプロセッシング施設(NPF)

【実習内容】

SrTiO₃誘電体薄膜形成とその結晶性・電気特性評価などを盛り込んだ機能性酸化物材料の開発のための基礎的なスキルを習得します。

【定員】3名(同時に実施いたします)

【案内/申し込み】<https://www.tia-kyoyo.jp/npf/seminar/2019-3/>

主催：産業技術総合研究所 TIA共用施設ステーション ナノプロセッシング施設(NPF)

共催 ナノエレクトロニクス計測分析技術研究会(TSC)

電子メール tia-npf-school3@aist.go.jp